

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁶
H01L 27/146

(11) 공개번호 특 1997-0077704
(43) 공개일자 1997년 12월 12일

(21) 출원번호	특 1996-0016465
(22) 출원일자	1996년 05월 16일
(71) 출원인	LG 반도체 주식회사 문정환
(72) 발명자	백의현
(74) 대리인	강용복, 김용인

심사청구 : 있음

(54) 마이크로 렌즈 패턴용 마스크

요약

본 발명은 반도체 소자에 관한 것으로, 특히 곡률 반경이 큰 마이크로 렌즈를 제조하기 위한 마이크로 렌즈 패턴용 마스크와 이를 이용한 마이크로 렌즈 제조방법에 관한 것이다.

이와 같은 마이크로 렌즈 패턴용 마스크는 투명기판, 상기 투명기판상에 소정영역에 형성되는 메인 차광영역, 그리고 상기 메인 차광층 주위에 형성되어 메인 차광층에서 멀어질수록 큰 빛의 진폭을 갖도록 형성되는 보조 차광영역을 포함하여 구성된 것으로 이를 이용하여 마이크로 렌즈를 제조하면 마이크로 렌즈의 곡률 반경이 커진다.

대표도

도 9

명세서

[발명의 명칭]

마이크로 렌즈 패턴용 마스크

[도면의 간단한 설명]

제 9도는 본 발명 제 1 실시예에 따른 마이크로 렌즈 패턴용 마스크의 투광 특성도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

투명기판; 상기 투명기판상의 소정영역에 형성되는 메인 차광영역; 그리고, 상기 메인 차광층 주변 또는 일부에 형성되어 메인 차광층에서 멀어질수록 큰 빛의 진폭을 갖도록 형성되는 보조 차광영역을 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 마이크로 렌즈 패턴용 마스크.

청구항 2

제 1항에 있어서, 상기 보조 차광영역을 투광영역으로 하고, 메인 차광영역으로부터 멀어질수록 상기 보조 차광영역을 통과하는 빛의 세기가 더 적게 함을 특징으로 하는 마이크로 렌즈 패턴용 마스크.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개되는 것임.

도면

도면9

